

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成18年9月7日(2006.9.7)

【公表番号】特表2005-536480(P2005-536480A)

【公表日】平成17年12月2日(2005.12.2)

【年通号数】公開・登録公報2005-047

【出願番号】特願2004-513274(P2004-513274)

【国際特許分類】

C 0 7 D 277/26 (2006.01)

C 0 7 F 7/18 (2006.01)

【F I】

C 0 7 D 277/26 C S P

C 0 7 F 7/18 A

【手続補正書】

【提出日】平成18年7月20日(2006.7.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

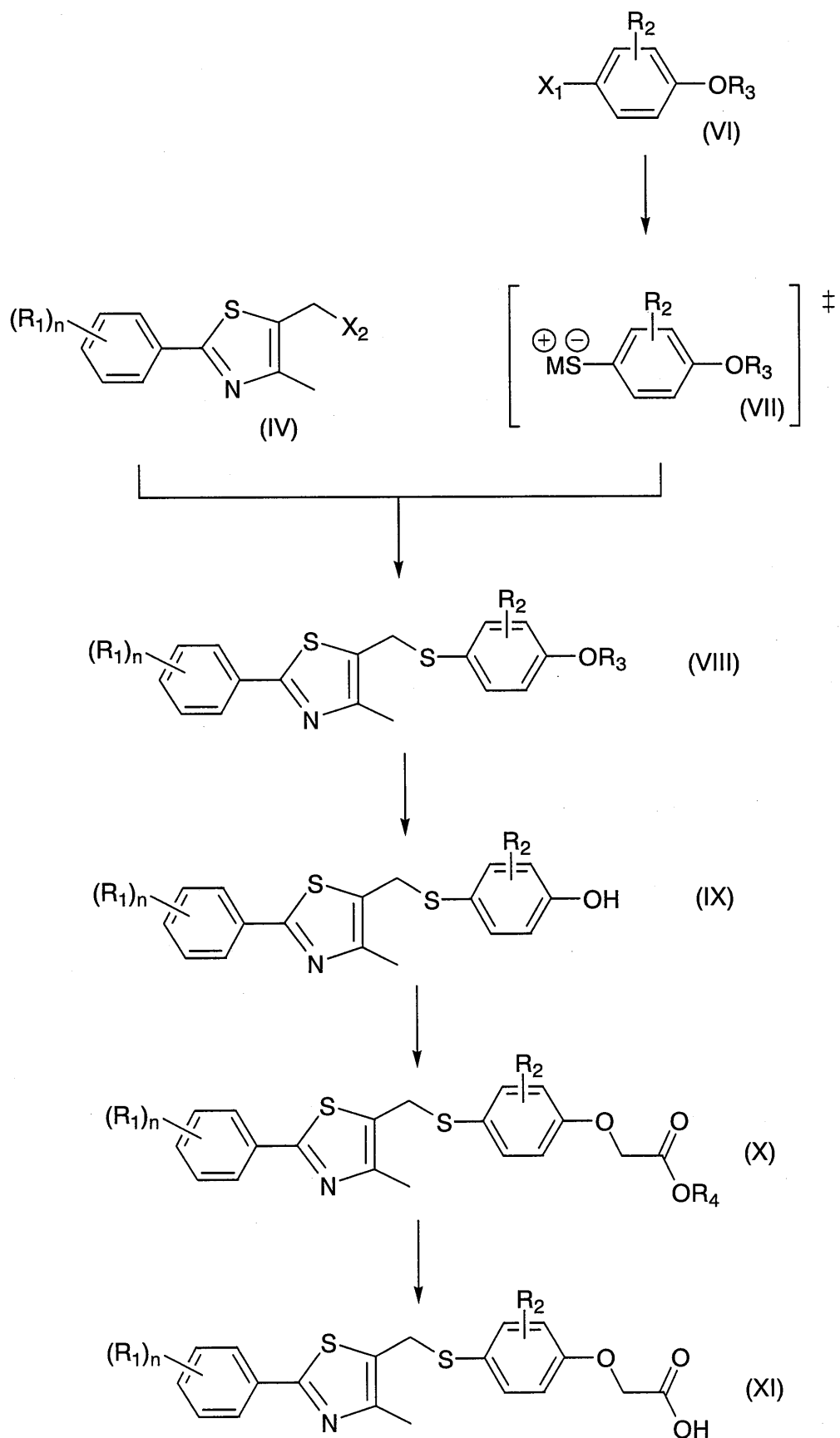
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(VI)の化合物から製造した一般式(VII)の金属チオラート中間体化合物と一般式(IV)の化合物とを反応させて一般式(VIII)の化合物を生成し、生成した一般式(VIII)の化合物の保護基を除去して一般式(IX)の化合物を得、それをハロゲン化酢酸アルキルと反応させて一般式(X)の化合物を製造し、一般式(X)の化合物を加水分解することを特徴とする、一般式(XI)の化合物の製造方法：

【化 1】



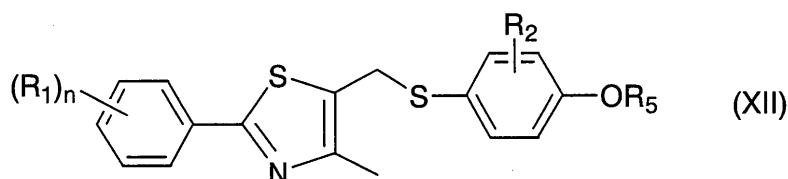
[式中、R₁は水素原子、CF₃、又はハロゲン原子を示し、nは0ないし5の整数を示し、R₂は水素原子又はフッ素原子、塩素原子、-(C₁-C₄)アルキル基、-O(C₁-C₄)アルキル基、-S(C₁-C₄)アルキル基、又は-N(C₁-C₄アルキル)₂基を示し、R₃はテトラヒドロピラニル基、-(C₁

-C₄)アルキル基、アリル基、又はシリル基を有する保護基を示し、R₄は-(C₁-C₄)アルキル基を示し、X₁はハロゲン原子を示し、X₂はハロゲン原子、又は求核剤により容易に置換される脱離基を示し、Mはリチウムイオン又はハロゲン(Cl、Br、又はI)化マグネシウムを示す]

【請求項2】

式(XII)の化合物

【化2】



[式中、R₁は水素原子、CF₃、又はハロゲン原子を示し、nは0ないし5の整数を示し、R₂は水素原子又はフッ素原子、塩素原子、-(C₁-C₄)アルキル基、-O(C₁-C₄)アルキル基、-S(C₁-C₄)アルキル基、又は-N(C₁-C₄アルキル)₂基を示し、R₅は水素原子、又はテトラヒドロピラニル基、-(C₁-C₄)アルキル基、アリル基、若しくはシリル基を有する保護基を示す]

【請求項3】

R₅が、テトラヒドロピラニル基、-(C₁-C₄)アルキル基、アリル基、若しくはシリル基を有する保護基である請求項2記載の化合物

【請求項4】

R₅が、水素原子である請求項2記載の化合物

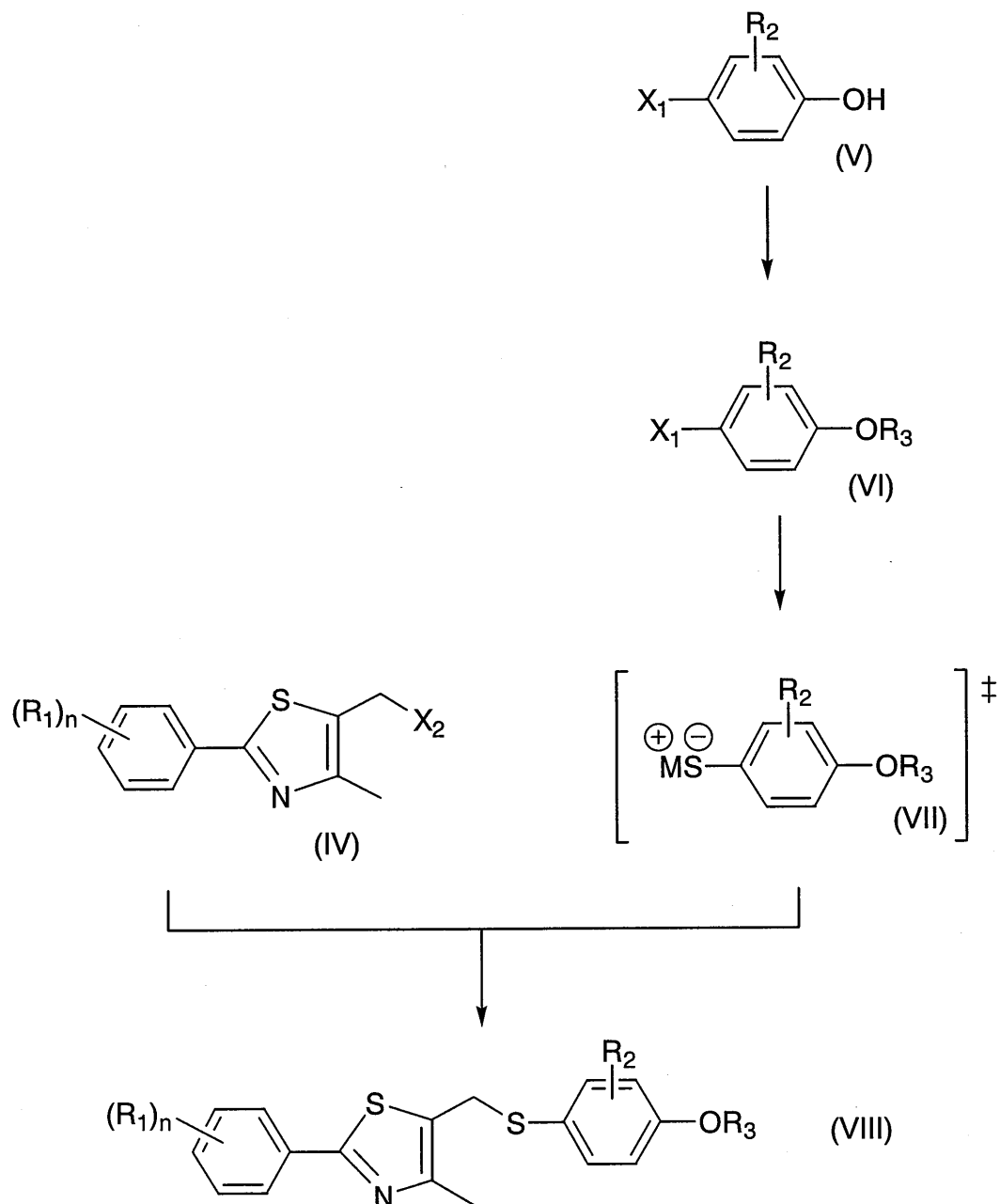
【請求項5】

R₁がCF₃であり、R₂がメチル基である請求項2に記載の一般式(XII)の化合物。

【請求項6】

一般式(V)の化合物のフェノール基を保護することにより一般式(VI)の化合物を得、一般式(VI)の化合物から製造した一般式(VII)の金属チオラート中間体化合物と一般式(IV)の化合物とを反応させることを特徴とする一般式(VIII)の化合物の製造方法：

【化 3】



[式中、 R_1 は水素原子、 CF_3 、又はハロゲン原子を示し、 n は0ないし5の整数を示し、 R_2 は水素原子又はフッ素原子、塩素原子、 $-(C_1-C_4)$ アルキル基、 $-O(C_1-C_4)$ アルキル基、 $-S(C_1-C_4)$ アルキル基、又は $-N(C_1-C_4)$ アルキル基を示し、 R_3 はテトラヒドロピラニル基、 $-(C_1-C_4)$ アルキル基、アリル基、又はシリル基を有する保護基を示し、 X_1 はハロゲン原子を示し、 X_2 はハロゲン原子、又は求核剤により容易に置換される脱離基を示し、 M はリチウムイオン又はハロゲン(Cl、Br、又はI)化マグネシウムを示す]